



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104096527 A

(43) 申请公布日 2014. 10. 15

(21) 申请号 201410354378. 1

(22) 申请日 2014. 07. 23

(71) 申请人 安庆市东徽机械有限公司

地址 246001 安徽省安庆市开发区发展企业
工业园 6 号

(72) 发明人 姚富年 余成杰 潘向阳 孔祥文
任春来 王金友 汪庆 韩志安
沈学旺

(51) Int. Cl.

B01J 19/18(2006. 01)

B01F 7/18(2006. 01)

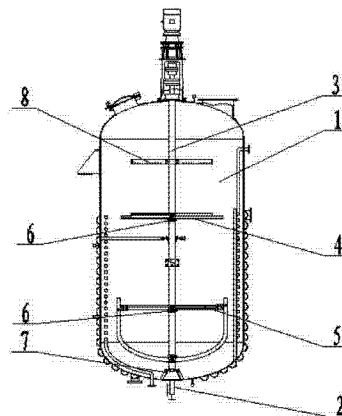
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

反应釜

(57) 摘要

本发明公开了一种反应釜,包括釜体,釜体底部设有出料管,顶部设有插入釜体内腔中的搅拌轴;沿所述搅拌轴的轴向方向上水平安装一组以上的桨式搅拌器,搅拌轴的轴向底部安装有框式搅拌器,釜体的内底壁中心设有底轴承,底轴承的底部支架固定在釜体的内底壁上,搅拌轴底端穿设在底轴承的中心轴承处。本发明结构简单,使用方便,通过对搅拌器的结构改进,并配合搅拌轴底部的底轴承的设置,可充分有效的搅拌混合物,能够有效提高搅拌的充分均匀度,实现物料的充分反应。



1. 一种反应釜,包括釜体,釜体底部设有出料管,顶部设有插入釜体内腔中的搅拌轴,其特征在于:沿所述搅拌轴的轴向方向上水平安装一组以上的桨式搅拌器,搅拌轴的轴向底部安装有框式搅拌器,釜体的内底壁中心设有底轴承,底轴承的底部支架固定在釜体的内底壁上,搅拌轴底端穿设在底轴承的中心轴承处。

2. 根据权利要求1所述的反应釜,其特征在于:所述桨式搅拌器、框式搅拌器均通过其中部的卡扣件紧固在搅拌轴上。

3. 根据权利要求1或2所述的反应釜,其特征在于:所述搅拌轴的轴向上端水平安装有除沫器。

反应釜

技术领域

[0001] 本发明涉及化工设备技术领域，具体涉及一种反应釜。

背景技术

[0002] 反应釜，其工作原理是利用电机带动搅拌轴搅拌，搅拌轴底端套设框式搅拌器，框式搅拌器运行时将釜体内的物料混合搅拌均匀，完成物料反应。此种搅拌结构的主要缺陷在于，物料无法实现完全的搅拌，易造成物料反应不充分，搅拌能力达不到生产的需求，影响了产品的质量。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述现有技术的不足，提供一种结构简单、使用方便、搅拌均匀充分的反应釜。

[0004] 一种反应釜，包括釜体，釜体底部设有出料管，顶部设有插入釜体内腔中的搅拌轴；沿所述搅拌轴的轴向方向上水平安装一组以上的桨式搅拌器，搅拌轴的轴向底部安装有框式搅拌器，釜体的内底壁中心设有底轴承，底轴承的底部支架固定在釜体的内底壁上，搅拌轴底端穿设在底轴承的中心轴承处。

[0005] 所述桨式搅拌器、框式搅拌器均通过其中部的卡扣件紧固在搅拌轴上。

[0006] 所述搅拌轴的轴向上端水平安装有除沫器。

[0007] 本发明结构简单，使用方便，通过对搅拌器的结构改进，并配合搅拌轴底部的底轴承的设置，可充分有效的搅拌混合物，能够有效提高搅拌的充分均匀度，实现物料的充分反应。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0009] 图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 以下结合具体实施例，对本发明做进一步说明。应理解，以下实施例仅用于说明本发明而非用于限制本发明的范围。

[0011] 参见图1，本发明提供的一种反应釜，包括釜体1，釜体1底部设有出料管2，顶部设有插入釜体1内腔中的搅拌轴3，为了解决背景技术中所述的技术问题，本发明的技术方案是，沿搅拌轴3的轴向方向上水平安装一组以上的桨式搅拌器4，搅拌轴3的轴向底部安装有框式搅拌器5，桨式搅拌器4、框式搅拌器5均通过其中部的卡扣件6紧固在搅拌轴3上，

釜体 1 的内底壁中心设有底轴承 7,底轴承 7 的底部支架固定在釜体 1 的内底壁上,搅拌轴 3 底端穿设在底轴承 7 的中心轴承处。

[0012] 使用时,桨式搅拌器 4、框式搅拌器 5 可根据需要进行位置、数量调整,底轴承 7 对搅拌轴 3 起到一个支撑作用,确保其旋转时的稳定性能,可充分有效的搅拌混合物,有效提高搅拌的充分均匀度。

[0013] 另外,在搅拌轴 3 的轴向上端水平安装有除沫器 8,用于除去在搅拌过程中物料所产生的泡沫,确保成品质量。

[0014] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

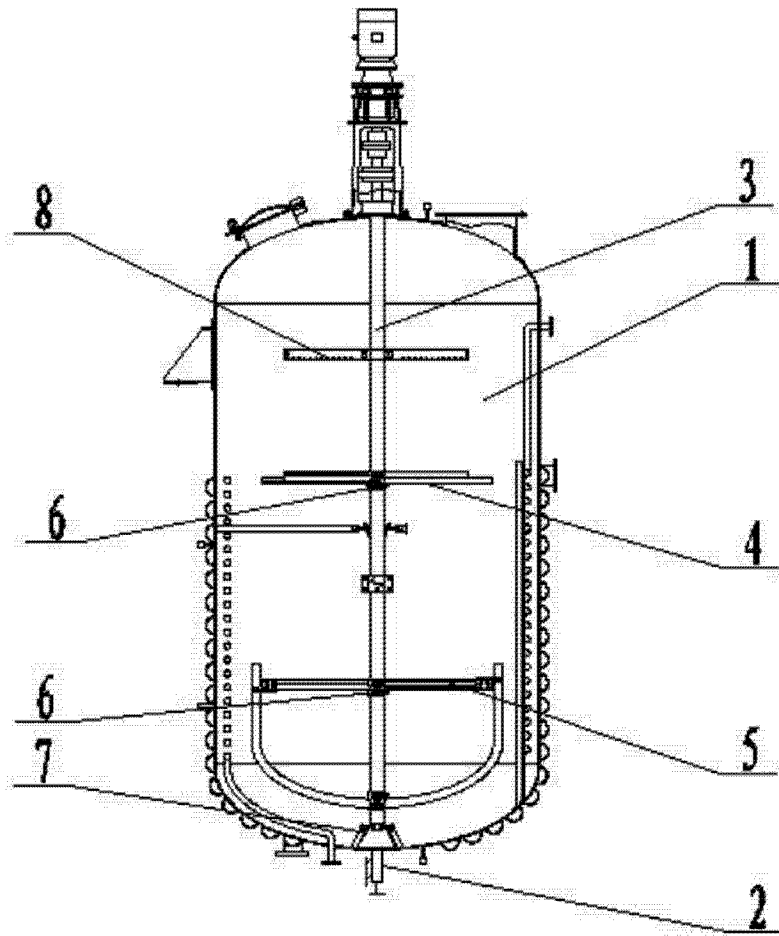


图 1